

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年1月27日 (27.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/008338 A1

(51) 国際特許分類⁷: G03F 7/027, G02F 1/1337

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/010184

(22) 国際出願日: 2004年7月16日 (16.07.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-275924 2003年7月17日 (17.07.2003) JP
特願2003-319750 2003年9月11日 (11.09.2003) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 日立成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 山田直毅 (YAMADA, Naoki) [JP/JP]; 斎藤学 (SAITOU, Manabu) [JP/JP]; 田仲裕之 (TANAKA, Hiroyuki) [JP/JP]; 山崎宏 (YAMAZAKI, Hiroshi) [JP/JP].

(74) 代理人: 三好秀和 (MIYOSHI, Hidekazu); 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目2番3号 虎ノ門第一ビル9階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 國際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。

(54) Title: NEGATIVE PHOTORESISTIVE RESIN COMPOSITION AND NEGATIVE PHOTORESISTIVE ELEMENT

(54) 発明の名称: ネガ型感光性樹脂組成物及びネガ型感光性エレメント



(57) Abstract: A negative photosensitive resin composition that can be formed into projections for control of liquid crystal alignment capable of realizing precision higher than that attained by the use of positive photosensitive resin compositions; and a photosensitive element produced from the above

negative photosensitive resin composition, which can be employed in a transfer method (laminating system) and can be easily stored to thereby enable use without wasting, excelling in film thickness stability. In particular, a negative photosensitive resin composition comprising an alkali soluble resin (a), a reactive monomer (b) and a photoreaction initiator (c) characterized in that 50% or more of the total mass of mixed reactive monomer (b) is occupied by a monofunctional reactive monomer; and a negative photosensitive element comprising a support and, superimposed thereon, a negative photosensitive resin composition layer consisting of the above negative photosensitive resin composition.

WO 2005/008338 A1

(57) 要約: 本発明は、ポジ型感光性樹脂組成物で形成されるもの以上の精度を実現する液晶配向制御用突起が形成可能な、ネガ型感光性樹脂組成物、及び、転写法(ラミネート方式)に用いることが可能な、保存が容易で無駄なく使うことが可能であり、膜厚安定性に優れる、前記ネガ型感光性樹脂組成物を用いた感光性エレメントを提供することを目的とする。本発明は、(a)アルカリ可溶性樹脂、(b)反応性モノマー、及び、(c)光反応開始剤を含有し、かつ、配合される(b)反応性モノマーの全質量部の50%以上を単官能性反応性モノマーが占めることを特徴とするネガ型感光性樹脂組成物、及び、支持体上に、前記ネガ型感光性樹脂組成物を用いたネガ型感光性樹脂組成物層を有するネガ型感光性エレメントに関する。